

2025 年 10 月 29 日
株式会社クラフティア

インドからの学生を受け入れ、インターンシッププログラムを実施しました

当社は、2025 年 10 月 7 日～17 日の期間、外務省の 2025 年度事業「インド次世代共創人材招へいプログラム [MIRAI-Setu]」の一環として、AFS (American Field Service) 日本協会の依頼により、インドからの IT 分野で学ぶ大学生・大学院生 4 名をインターンシップとして受け入れました。

インドの学生に対して、当社の事業内容や、情報通信部門・DX 部門における業務内容を知ってもらうことで、将来的な人材獲得のパイプラインを構築することを目的としてこの度のインターンシップを実施しました。



前列左から 2 人目シン シュッタルダさん、3 人目ダディッチ アディティアさん、5 人目パティル ビューシュさん(インド工科大学ハイデラバード校)、右端フルッパ シバシンさん(インド情報技術大学ジャバルプール校)

■実施の背景

日本では、2030 年に最大 79 万人の IT 人材が不足すると言われるなど、人材の確保が喫緊の課題であり、諸外国の優秀な人材の獲得・活用が急務となっています。そうした中、インドでは、工学系の学生が毎年約 150 万人卒業すると言われインド人に対する世界的な人材の獲得競争が進んでいます。

日本は他国と比較してインド人材の獲得は更なる拡大の余地がある状況であるため、インド人材、日本企業の双方が、互いのニーズや習慣に関する理解を一層深めることが重要です。

本プログラムは、インドの大学生および大学院生（若手研究者）計 40 名を招聘し、インド人材と日本企業との相互理解を促進することで、両国の経済・社会の発展に貢献する人材の育成を目指すものです。また、持続可能な日印間のパートナーシップ構築を目的としています。

■インターンシップの内容(一例)

- ・当社本社でのオリエンテーション
- ・視察訪問

当社教育施設(クラフティアアカデミー)、関連会社(株ネット・メディカルセンター)等

- ・JR 長崎駅・長崎スタジアム等、当社施工済み現場の訪問
- ・日本が重視する働き方の協働・共創ワークショップ、アジャイルワークの講義



クラフティアアカデミーでの座禅体験



長崎スタジアム見学



当社 DX 推進部とのワークショップ



成果発表会

最終日の成果発表会では、日印の比較、自身の研究と当社の技術との融合によるシナジー効果など、独自の視点と多彩な内容が発表され、非常に充実した提言をいただきました。

インターンシップを通して、学生からは「クラフティアでの体験は非常に充実していた」「思いやりと配慮のある対応に感謝している」といった声が寄せられました。

今回のインターンシップは、学生たちにとって大きな学びと成長の機会となったとともに、当社にとっても新たな可能性を切り拓く貴重な経験となりました。

当社は今後も国際的な人材と共に成長し、更なるイノベーションを創出する企業を目指してまいります。

以 上